



ORIGINAL

क्रम सं/ Serial No.: 172346



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

डिजाइन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

Certificate of Registration of Design

डिजाइन सं. / Design No.

408407-001

तारीख / Date

22/02/2024

पारस्परिकता तारीख / Reciprocity Date\*

देश / Country

प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न प्रति में वर्णित डिजाइन जो **MICROREACTOR FOR NANOPARTICLE SYNTHESIS** से संबंधित है, का पंजीकरण, श्रेणी 24-01 में 1.Dr. Ritesh Fule 2. Dr. Mangesh Dinanath Godbole 3.Dr. Mohammed Kaleem 4.Dr. Shailesh M Kewatkar 5.Dr. Abhijeet Dattatraya Kulkarni के नाम में उपर्युक्त संख्या और तारीख में कर लिया गया है।

Certified that the design of which a copy is annexed hereto has been registered as of the number and date given above in class 24-01 in respect of the application of such design to **MICROREACTOR FOR NANOPARTICLE SYNTHESIS** in the name of 1.Dr. Ritesh Fule 2. Dr. Mangesh Dinanath Godbole 3.Dr. Mohammed Kaleem 4.Dr. Shailesh M Kewatkar 5.Dr. Abhijeet Dattatraya Kulkarni.

डिजाइन अधिनियम, 2000 तथा डिजाइन नियम, 2001 के अधधीन प्रावधानों के अनुसरण में।

In pursuance of and subject to the provisions of the Designs Act, 2000 and the Designs Rules, 2001.

जारी करने की तिथि :

Date of Issue

07/06/2024



कुलत की संस्थिति

महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न  
Controller General of Patents, Designs and Trade Marks

\*पारस्परिकता तारीख (यदि कोई हो) जिसकी अनुमति दी गई है तथा देश का नाम। डिजाइन का स्वत्वाधिकार पंजीकरण की तारीख से दस वर्षों के लिए होगा जिसका विस्तार, अधिनियम एवं नियम के निबंधनों के अधीन, पाँच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए किया जा सकेगा। इस प्रमाण पत्र का उपयोग विधिक कार्यवाहियों अथवा विदेश में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए नहीं हो सकता है।

The reciprocity date (if any) which has been allowed and the name of the country. Copyright in the design will subsist for ten years from the date of Registration, and may under the terms of the Act and Rules, be extended for a further period of five years. This Certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining registration abroad.